

平成20年4月29日

各位

IBM社との次世代半導体製造プロセス技術における共同開発の件

大陽日酸株式会社（社長：松枝 寛祐）は、100%子会社の Matheson Tri-Gas（米国）を通じ、IBM社と32nm以降の次世代半導体材料及び半導体プロセス技術における4年間の共同開発を行うことになりましたのでお知らせ致します。本共同開発は大陽日酸グループにとって半導体プロセス技術におけるIBM社との最初の共同開発となります。

半導体産業の技術の進歩に伴い、半導体製造メーカーは半導体デバイスの更なる集積化に対応するため新規技術の開発への急速な対応を迫られています。IBMはトランジスターレベルで継続的に最先端の半導体製造技術を開発するため、原子スケールの半導体製造技術の開発においてMatheson Tri-Gas/大陽日酸グループと共同で画期的な高純度材料ガスと材料ガス供給システムの開発を実施します。この共同開発は大陽日酸、Matheson Tri-Gas、IBMのそれぞれからの研究員により、米国のアルバニー市（ニューヨーク州）に位置するCollege of Nanoscale Science and Engineeringのアルバニーナノテクノロジーセンターにて実施される予定です。

一方、IBMの技術最高責任者兼戦略的アライアンス担当副社長のマイヤソン博士は、「大陽日酸及びMatheson Tri-Gasの最先端材料ガス技術とIBMの保有するCMOS技術を合わせることで、両社の半導体製造技術分野におけるイノベーションのペースを画期的に加速することが可能となるであろう。」とコメントしました。

本件に関するお問合せ先

大陽日酸株式会社
品川区小山1-3-26 東洋Bldg.
電子機材事業本部事業戦略推進部 星
総務本部社長室広報部 田島、鎌田
TEL 03-5788-8015